

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ตั้งแต่การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และแถบพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

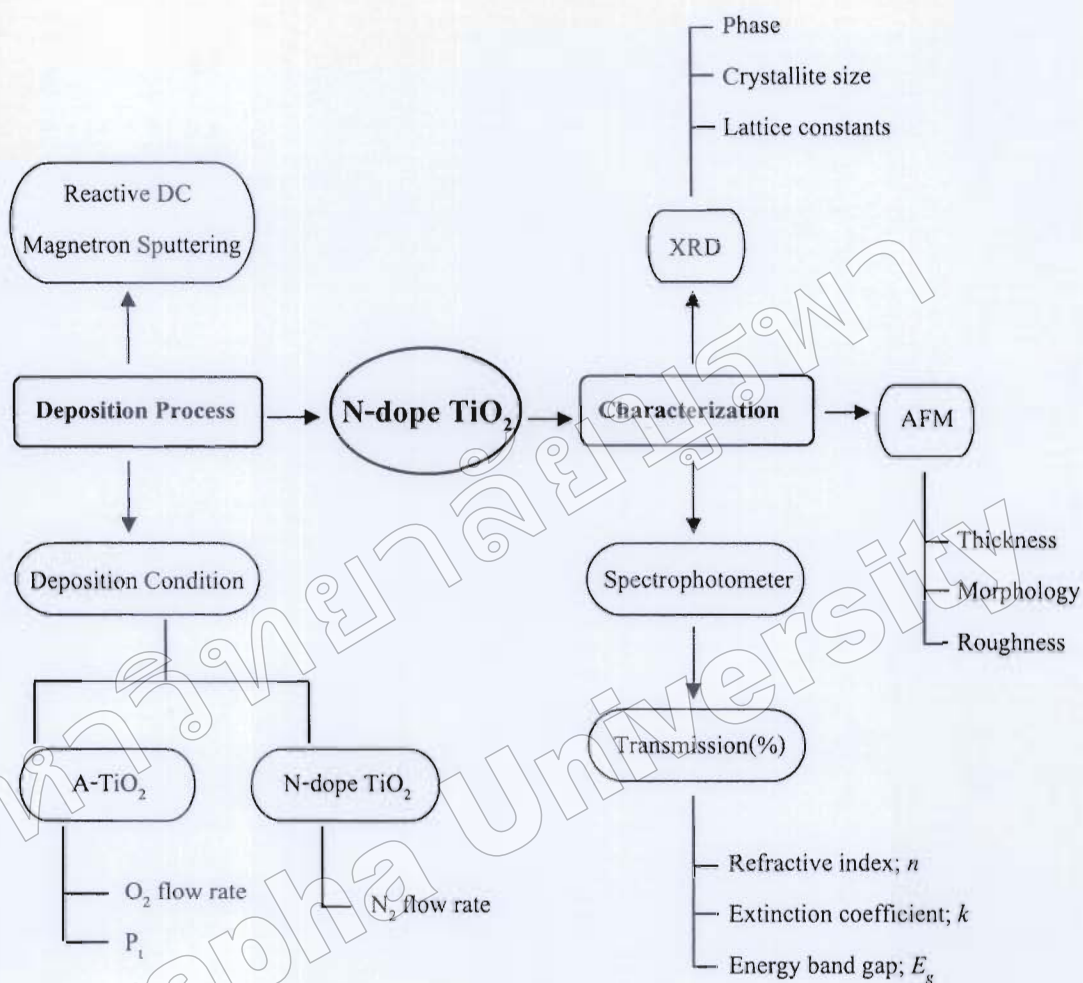
กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์นี้เป็น 4 ส่วนคือ (1) การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส (2) การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน (3) การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน และ (4) การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน สรุปได้ดังนี้

การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลือบ ตัวแปรและขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบด้วยวิธีรีเอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง จากนั้นจึงทดลองเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส โดยศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนและความดันรวม ต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ และทดลองเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน โดยศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สในโตรเจน ต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบได้ ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ (Lattice Constants) และใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว

สำหรับสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ศึกษาโดยนำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั้นนำค่าการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคำนวณหาค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และแถบพลังงาน



ภาพที่ 3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโคโรเงิน

1.1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบรีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-2)

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบเป็นเป้าไทเทเนียม มีความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- กระดาษไคลด์ใช้เพื่อศึกษาสมบัติทางแสง
- แผ่นซิลิกอนใช้ในการศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ

ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 3 ชนิดคือ

- แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สปัตเตอริง (Sputtered Gas)
- แก๊สออกซิเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive Gas)
- แก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สเจือ (Doped Gas)

2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบาง

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-ray Diffractometer Bruker รุ่น D8 โดยใช้ $\text{Cu-K}\alpha$ ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาพที่ 3-3)

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพที่ 3-4)

2.3 Spectrophotometer สำหรับวัดค่าการส่งผ่านแสงในช่วง 200-2500 nm งานวิจัยนี้จะใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น UV-VIS-NIR 3600 (Shimadzu Co., Ltd) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบรีแอกตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractometer



(a)



(b)

ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope



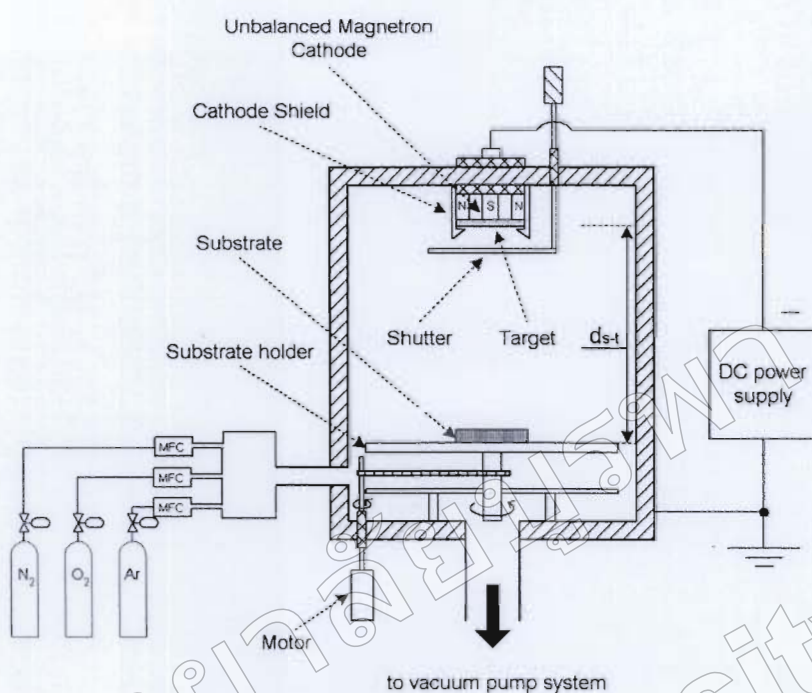
ภาพที่ 3-5 เครื่อง Spectrophotometer

เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบรีแอคทีฟดีซีสเปดเตอริง

ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนในงานวิทยานพชนนี้เตรียมจากเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบดีซีอานบาลานซ์แมกนีตรอนสเปดเตอริง (ภาพที่ 3-6) ด้วยเทคนิครีแอคทีฟสเปดเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้สภาวะสุญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับ 10^{-5} mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสเปดเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

1. ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเครื่องสูบลสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบบแบบแฟรไอแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบลโรตารีเป็นเครื่องสูบลท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรานีรุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050

2. ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนประกอบด้วย แมกนีตรอนคาโทด 2 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54.0 mm ระบายความร้อนด้วยน้ำ ติดตั้งเป้าไทเทเนียม (99.99%) ที่คาโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ใช้แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสเปดเตอริง ใช้แก๊สออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) และแก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สำหรับการจ่ายแก๊สอาร์กอนแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบจะควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D



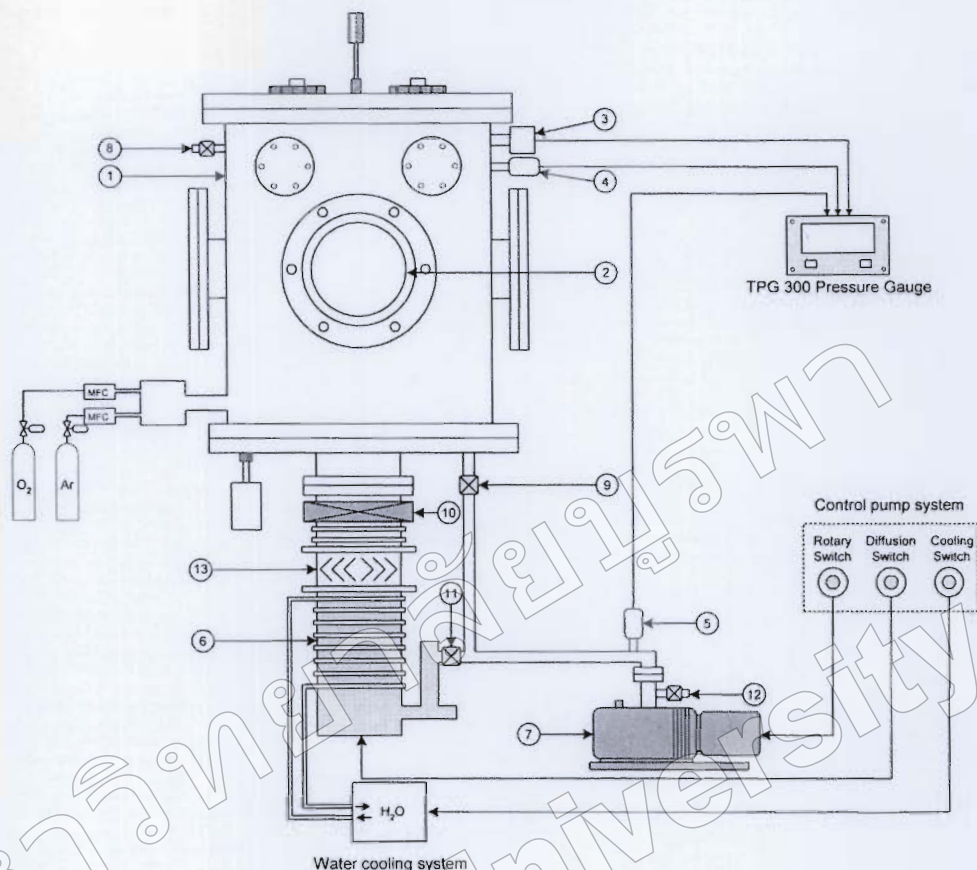
ภาพที่ 3-6 โคออร์ดิเนตของเครื่องเคลือบ

การสร้างสถานะสุญญากาศ

ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอริง ต้องทำความสะอาดในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสถานะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ $10^{-3} - 10^{-5}$ mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้เนื่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสถานะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบลสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) หนุนหลังด้วยเครื่องสูบลกลโรตารี (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-7) โดยในตอนต้นจะใช้เครื่องสูบลกลโรตารีเพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยากาศเป็นความดันต่ำประมาณ 10^{-2} mbar ต่อมาจะใช้เครื่องสูบบแบบแพร่ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจาก 10^{-2} mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน 10^{-5} mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจสอบเช็ควาล์วหยาบ (หมายเลข 9) วาล์วท้าย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตช์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบลสุญญากาศ เป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตช์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบลโรตารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบลอากาศจากเครื่องสูบลแบบแพร่ไอ โดยใช้เครื่องสูบลโรตารี โดยเปิดวาล์วท้าย เพื่อให้เครื่องสูบลโรตารีสูบลอากาศออกจากเครื่องสูบลแบบแพร่ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบลแบบแพร่ไอ เมื่ออ่านจากพิราณีเกจ (หมายเลข 4) มีค่าน้อยกว่า 10^{-2} mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบลแบบแพร่ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตช์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความร้อนของเครื่องสูบลแบบแพร่ไอทำงานเป็นการเริ่มต้มน้ำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในภาชนะสุญญากาศ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันใน ภาชนะสุญญากาศยังคงอยู่ในสภาวะเป็นสุญญากาศหรือไม่ ถ้ายังเป็นสุญญากาศก็ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศเท่ากับความดันบรรยากาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญากาศออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสุญญากาศขั้นต้นในภาชนะสุญญากาศโดยใช้เครื่องสูบลโรตารี โดยการปิดวาล์วท้าย แล้วเปิดวาล์วหยาบเพื่อให้เครื่องสูบลโรตารีสูบลอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศ มีค่าประมาณ 10^{-2} mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
6. เมื่อต้มน้ำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูง ในภาชนะสุญญากาศด้วยเครื่องสูบลแบบแพร่ไอ โดยปิดวาล์วหยาบ แล้วเปิดวาล์วท้าย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศสูง เพื่อให้เครื่องสูบลแบบแพร่ไอสูบลอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อทำความดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง $10^{-5} - 10^{-6}$ mbar
7. จัปเวลาและรอนจนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ 5×10^{-5} mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น (P_p) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มไทเทเนียมเจือไนโตรเจน

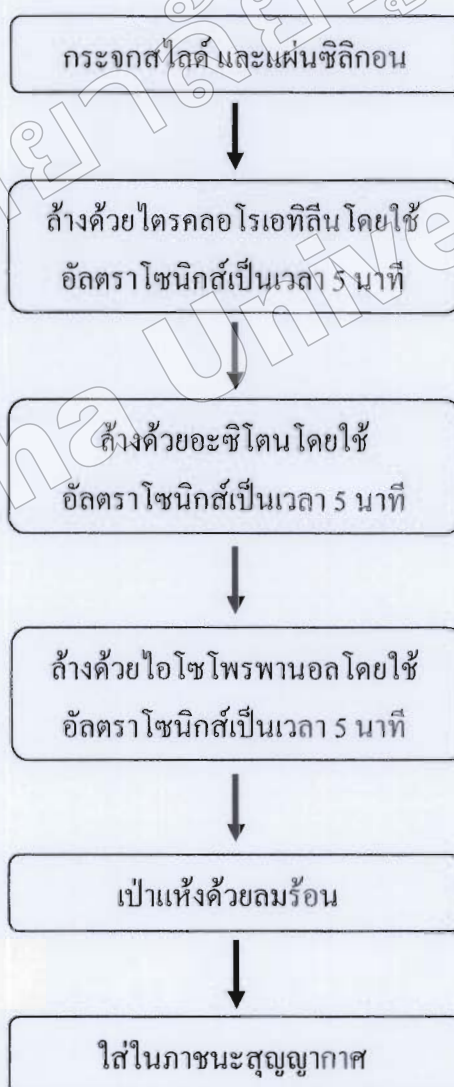


ภาพที่ 3-7 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบลูญากาศ ของระบบเคลือบสปีดเตอริง

- | | |
|---|--|
| 1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum Chamber) | 2. หน้าต่าง (Window) |
| 3. มาตรวัดความดันเพนนิ่ง (Penning Gauge) | 4. มาตรวัดความดันพิรานี (Pirani Gauge) |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบลูกโรตารี (Rotary Pump) | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 9. วาล์วหยาบ (Roughing Valve) | 10. วาล์วสุญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve) | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 13. แบริล (Baffle) | |

การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่น ไขมัน สารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผิววัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวหน้าของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปล้างด้วยไอโซโพรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมคีบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสุญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-8



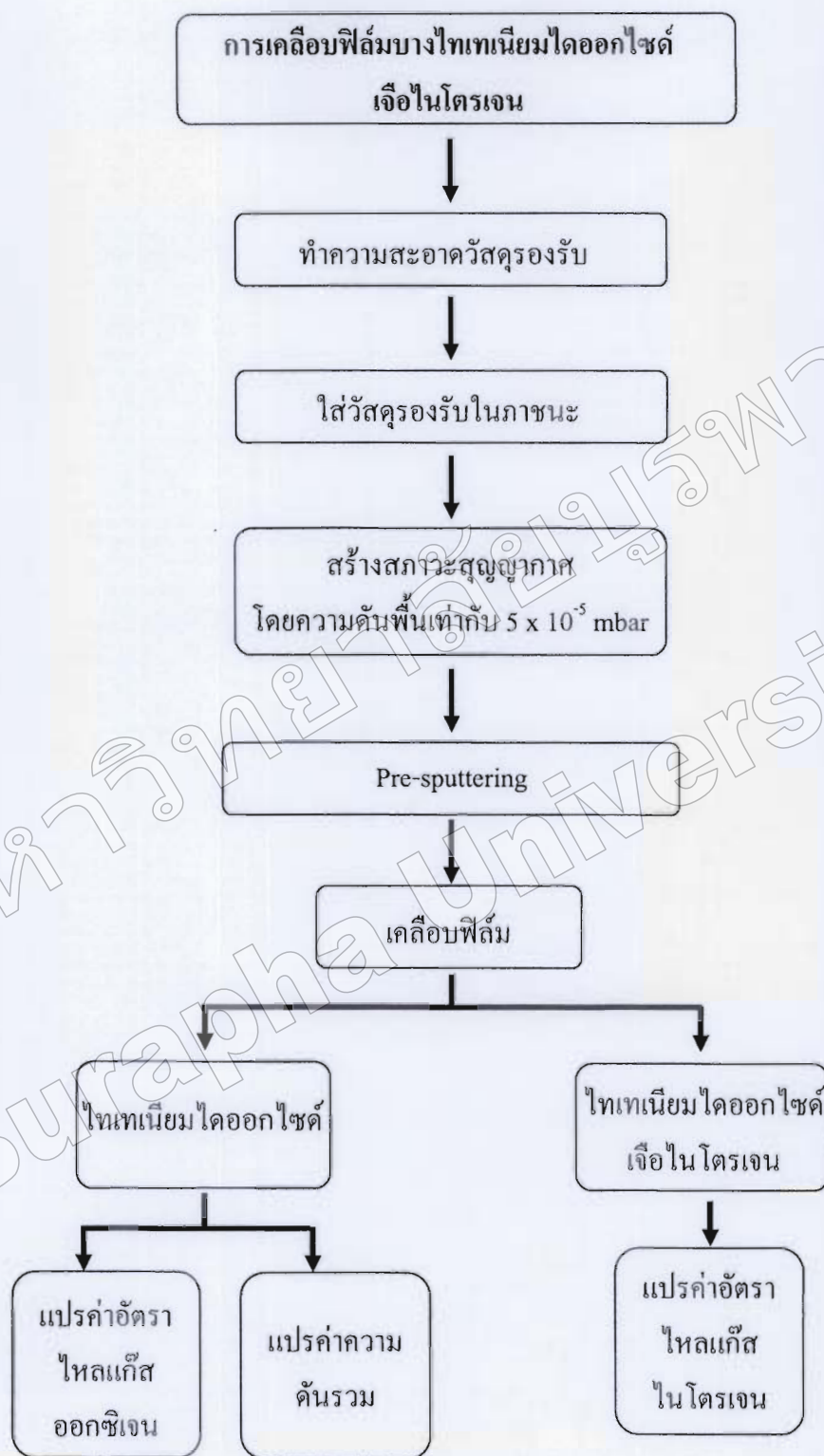
ภาพที่ 3-8 การล้างวัสดุรองรับ

การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจน

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสุญญากาศด้วยวิธีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อสัคกีไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วคาโทดและต่อสัคกีไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสุญญากาศ เป้าไทเทเนียมจะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อกับระบบไหลเวียนน้ำเย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปัตเตอริงของไอออนอาร์กอนที่บริเวณผิวหน้าเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ โดยชัตเตอร์ (Shutter) ใช้สำหรับกั้นระหว่างวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบ เพื่อป้องกันการเคลือบผิววัสดุรองรับ ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหน้าเป้า (Pre Sputtering) และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้บังคับการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊สอย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนที่เข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ โดยค่าอัตราการไหลของแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (sccm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนมีรายละเอียดดังนี้

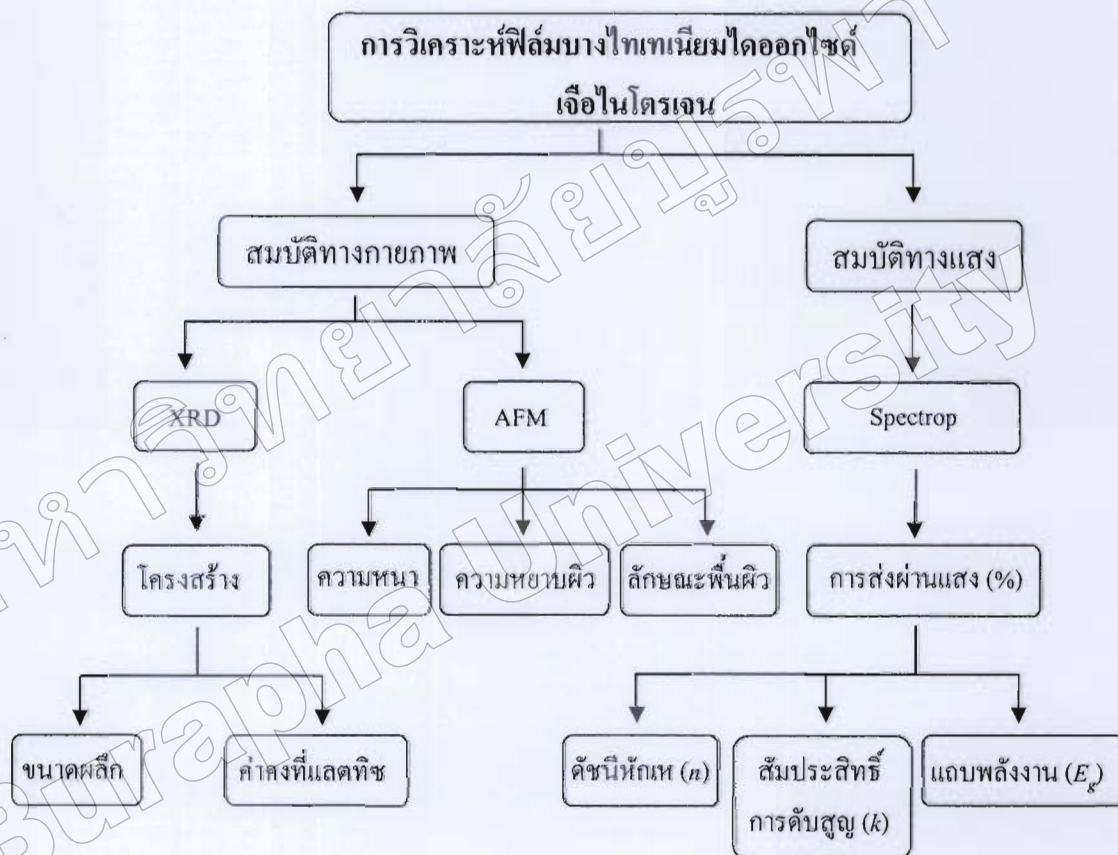
1. นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุรองรับ ปิดชัตเตอร์หน้าเป้าไทเทเนียม แล้วปิดฝาภาชนะสุญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศเท่ากับ 5×10^{-5} mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น (P_0) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน P_0 ที่อ่านได้
3. ทำความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ Pre-Sputtering เป็นเวลา 3 นาที
4. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายสัคกีไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิดโกลว์ดีสชาร์จ (ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยเปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้งบันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) ค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (P) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา (t) ที่กำหนด
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสุญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออก



ภาพที่ 3-9 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจน

การวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

การวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน และ (2) สมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน



ภาพที่ 3-10 การวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

1. โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนชั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ลักษณะพื้นผิวและความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านการเคลือบแล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เกิดขึ้น โดยจะใช้ $\text{Cu-K}\alpha$ เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง $20^\circ - 65^\circ$ สเปกตรัมที่วัดได้นำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มาตรฐานอ้างอิงของแฟ้ม JCPDS

1.2 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนสามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractometer โดยใช้ Scherrer Equation ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้หลังการเคลือบ

1.3 การหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน สำหรับการหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนสามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล ในการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้หลังการเคลือบ

1.4 การหาความหนาของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิกอนไนไตรด์เคลื่อนที่กราดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา

1.5 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

2. สมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน ชั้นนี้คำนวณหา ค่าคงที่ทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือใน ไตรเจนด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ วัดค่าการส่งผ่านแสงบนกระจกสไลด์ที่เป็นวัสดุรองรับ แล้วนำมาคำนวณหา ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแถบพลังงาน

2.1 การหาดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางหาจากวิธี Envelope โดยใช้ข้อมูลจากสเปกตรัม การส่งผ่านแสงในการคำนวณซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 การหาดัชนีหักเห (n)

2.1.1.1 นำฟิล์มบางที่เคลือบบนกระจกสไลด์ไปทำการวัดเปอร์เซ็นต์ การส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

2.1.1.2 นำเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงไปเขียนกราฟ โดยให้แกน x เป็นแกน ของความยาวคลื่น และแกน y เป็นแกนของเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสง

2.1.1.3 สร้างช่องครอบสเปกตรัมการส่งผ่านแสงโดยการลากเส้นผ่านค่าสูงสุด (T_M) และค่าต่ำสุด (T_m) ของสเปกตรัมการส่งผ่านแสงตลอดช่วงความยาวคลื่นที่สนใจดังภาพที่ 3-10

2.1.1.4 ลากเส้นตรงตั้งฉากกับแกน x ที่ความยาวคลื่นที่สนใจให้ตัดกับช่องที่ สร้างขึ้น ดังภาพที่ 3-11

2.1.1.5 นำค่า T_M และ T_m ที่ได้ไปแทนในสมการ 3-1

$$N = 2s \frac{T_M - T_m}{T_M T_m} + \frac{s^2 + 1}{2} \quad (3-1)$$

$$\text{เมื่อ } s = \frac{1}{T_s} + \sqrt{\frac{1}{T_s^2} - 1} \quad (3-2)$$

เมื่อ s คือ ดัชนีหักเหของกระจกสไลด์ และ T_s เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าการส่งผ่าน แสงของกระจกสไลด์

2.1.1.6 นำค่า N ที่ได้จากสมการ 3-1 ไปแทนในสมการ 3-3 จะได้ ดัชนีหักเห (n) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$n = \sqrt{N + \sqrt{N^2 - s^2}} \quad (3-3)$$

2.1.2 การหาสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k)

2.1.2.1 สัมประสิทธิ์การดูดกลืน ($\alpha_{(\lambda)}$) คำนวณได้จากสมการที่ 3-4

โดย d เป็นความหนาของฟิล์ม

$$\alpha_{(\lambda)} = -\frac{1}{d} \ln x \quad (3-4)$$

เมื่อ

$$x = \frac{F - \sqrt{F^2 - (n^2 - 1)^3 (n^2 - s^4)}}{(n - 1)^3 (n + s^4)} \quad (3-5)$$

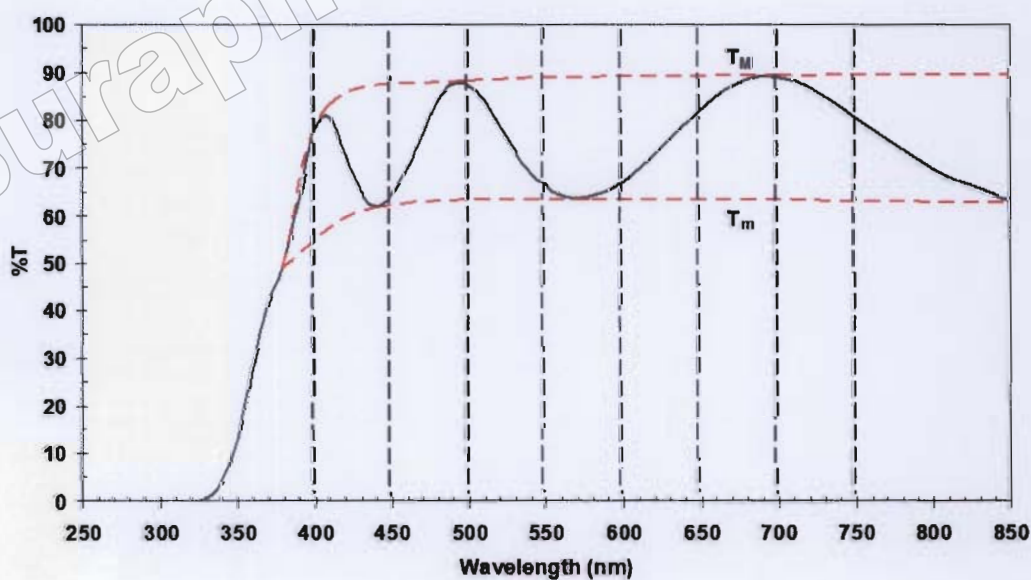
$$F = \frac{8n^2 s}{T_i} \quad (3-6)$$

และ

$$T_i = \frac{2T_M T_m}{T_M + T_m} \quad (3-7)$$

2.1.2.2 แทนค่า α จากสมการที่ 3-4 ในสมการที่ 3-8 จะได้สัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad (3-8)$$



ภาพที่ 3-11 ตัวอย่างของ (Envelope) และการเลือกค่าการส่งผ่านแสงสำหรับการคำนวณหา
ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ

2.2 การหาแถบพลังงาน (E_g)

ค่าแถบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ในงานวิจัยนี้ สามารถคำนวณจากสมการที่ 3-9

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m \quad (3-9)$$

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืน

$h\nu$ คือ พลังงานแสง

A คือ ค่าคงที่

E_g คือ ช่องว่างพลังงาน

m คือ ค่าคงที่โดยมีค่าขึ้นกับ Transition Mode ของสารกึ่งตัวนำ โดยที่

$m = 1/2$: Direct Allowed Transition

$m = 2$: Indirect Allowed Transition

โดยค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (α) หาได้จากสมการที่ 3-10

$$\alpha = -\frac{\ln T}{d} \quad (3-10)$$

เมื่อ T คือ การส่งผ่านแสง

d คือ ความหนาของฟิล์ม

ทั้งนี้ Chiu et al. (2007) ได้อธิบายว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำแบบ Indirect Allowed Transition และค่าแถบพลังงาน (E_g) มีค่าเท่ากับจุดตัดบนแกน x ของกราฟระหว่าง $(\alpha h\nu)^{1/2}$ กับ $h\nu$

แนวทางการทดลอง

งานวิจัยนี้ แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนดังนี้

การทดลองที่ 1 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส

วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อยดังนี้

การทดลองที่ 1.1 การศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน โดยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนคงที่เท่ากับ 5 sccm และแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm, 10 sccm และ 15 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 7×10^{-3} mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-1)
2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป่าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเป่าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	5, 10, 15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 1.2 การศึกษาผลของความดันรวม

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความดันรวมที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนโดยการแปรค่าความดันรวมในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 5 : 15 sccm แปรค่าความดันรวมควบคุมความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar, 5×10^{-3} mbar, 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar ตามลำดับ และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-2)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าความดันรวม

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป่าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	3×10^{-3} , 5×10^{-3} , 7×10^{-3} , 9×10^{-3}
ระยะระหว่างเป่าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 2 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม
 ไดออกไซด์เจือในไตรเจน มีการทดลองดังนี้

การทดลองที่ 2.1 การศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สในไตรเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบาง
 ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ
 ในไตรเจนบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนโดยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนในการเคลือบ
 เพื่อหาอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ
 ในไตรเจน โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 5 : 15 sccm
 แปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0 sccm, 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm ตามลำดับ
 ควบคุมความดันรวมให้คงที่เท่ากับ 7×10^{-3} mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-3)
2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก
 ค่าคงที่แลตทิซ ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-3 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	0, 1, 2, 3
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 3 การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราไหลเกิดสในโตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน

การศึกษาสมบัติทางแสง และแถบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน โดยนำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบบนกระจกสไลด์จากการทดลองที่ 2 ไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แล้วนำมาคำนวณหาดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดูดกลืน ด้วยวิธี Envelope ส่วนแถบพลังงานคำนวณจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง จากสมการ $\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m$ เมื่อ $m = 2$ (Indirect Allowed Transition) (Chiu et al., 2007) โดยค่าแถบพลังงาน (E_g) มีค่าเท่ากับจุดตัดบน แกน x ของกราฟระหว่าง $(\alpha h\nu)^{1/2}$ กับ $h\nu$